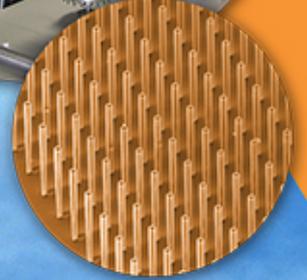


Villeneuve d'Ascq, IEMN
du 22 au 24 mai 2018

Atelier GDR CNRS Pulse

Préparation des substrats pour l'épitanaxie



Session 1 Préparation de surface pour l'intégration hétérogène

Charles Cornet (INSA Rennes)

« La préparation du Silicium pour l'hétéroépitanaxie »

Christophe Figuet (SOITEC)

« La préparation des substrat SOI pour l'intégration hétérogène »

Session 2 Structuration des substrats par gravure

Luc Favre (IM2NP)

« La préparation des substrats de Si pour la croissance de nanostructures SiGe »

Chantal Fontaine (LAAS) & Laurent Cerutti (IES)

« La préparation des substrats III-V pour la reprise d'épitanaxie »

Session 3 L'épitanaxie sélective III-Nitrures

Guy Feuillet (CEA-LETI)

« Croissance sélective de matériaux nitrures : technologies et applications aux structures émissives »

Session 4 Croissance VLS et croissance sélective de matériaux III-V

Sébastien Plissard (LAAS)

« Préparation des substrats pour la croissance VLS de nanofils »

Ludovic Desplanque (IEMN)

« Préparation des substrats pour la croissance sélective de matériaux III-V »

+ Session Posters

LILLE

IEMN Institut d'Electronique,
de Microélectronique et de Nanotechnologie
U.M.R C.N.R.S 8520
Laboratoire Central - Cité Scientifique
Avenue Poincaré
59652 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Inscription gratuite avant le 2 avril 2018
<https://atelier-pulse.sciencesconf.org>